



B. Patterning 분과

2019년 2월 14일(목), 11:00-12:30

Room I (매실, 5층)

[T12-B] EUV Lithography I

좌장: 허수미 교수(전남대학교)

<p>T12-B-1 11:00-11:30</p>	<p>[초청] Challenge of EUVL Technology for Industrialization in the Real World Han-Ku Cho <i>BD FM Strategic Marketing, ASML Korea</i></p>
<p>T12-B-2 11:30-11:45</p>	<p>Imaging Behavior of Highly Fluorinated Molecular Resists under Extreme UV Radiation 오현택¹, 정석현², 문정석¹, 김강현³, 이상설³, 이진균¹ ¹인하대학교 고분자공학과, ²Materials Science and Engineering, Cornell University, ³포항 가속기연구소</p>
<p>T12-B-3 11:45-12:00</p>	<p>고 개구수 극자외선 노광공정용 위상변위 마스크 제작 및 성능 평가 김정식¹, 정동민², 이종화⁴, 최민기⁴, 공길우⁴, 안진호^{1,2,3} ¹한양대학교 나노반도체공학과, ²한양대학교신소재공학과, ³한양대학교 나노과학기술연구소, ⁴에스앤에스텍 IC 선행팀</p>
<p>T12-B-4 12:00-12:15</p>	<p>Removal of EUV Exposed Hydrocarbon from Ru Capping Layer of EUV Mask Using the Mixture of Alkaline Solutions and Organic Solvents Hyun-Tae Kim¹, Hye-Keun Oh³, Jinho Ahn⁴, and Jin-Goo Park^{1,2} ¹Department of Bio-Nano Technology, Hanyang University, ²Department of Material Science and Chemical Engineering, Hanyang University, ³Department of Applied Physics, Hanyang University, ⁴Department of Materials science and Engineering, Hanyang University</p>
<p>T12-B-5 12:15-12:30</p>	<p>Performance and Applications of EUV Scanning Lensless Imaging (ESLI) 우동곤¹, 김영웅¹, 장용주², 위성주¹, 안진호^{1,2,3} ¹한양대학교 신소재공학과, ²한양대학교 나노반도체공학과, ³한양대학교 나노과학기술연구소</p>